

# 「真空技術在半導體產業之應用/研討會」

- ◎ 特色：真空技術在半導體工業扮演重要角色，舉凡半導體的四項主要製程：薄膜，蝕刻，微影和擴散都少不了真空設備的使用。本研討會將著重在研討真空技術在目前及未來發展趨勢半導體產業的應用。會中邀請半導體真空零組件與系統設備製造商與使用者做介紹。
- ◎ 目的：培養參加人員對半導體真空零組件與系統設備目前使用情形與未來發展趨勢有系統性觀念，對想從事，已從事或半導體產業有興趣瞭解人員有幫助。
- ◎ 主辦單位：台灣真空學會
- ◎ 協辦單位：國立成功大學電機系，國立清華大學材料
- ◎ 適合對象：真空腔體元件製造廠家之工程師、技術員；研究機構及學術單位之研究人員、教師學生及操作維護真空系統之技術工程師及對半導體相關產業及有興趣者
- ◎ 第一場日期：台南市 2018 年 2 月 26 日(星期一)
- ◎ 第二場日期：新竹市 2018 年 2 月 27 日(星期二)
- ◎ 報名方式：「登入」本學會網站線上報名系統「填妥」報名資料「提交」送出完成報名。
- ◎ 費用：
  - (1)非會員：新台幣 1,800 元。
  - (2)會員價：新台幣 1,500 元。
  - (3)學生憑有效學生證優惠價 1,300 元
  - (4) 三人（含）以上一同報名者，每人費用再享 200 元折價優惠。
  - (5)以上報名者均含午餐。
- ◎ 繳款方式：
  - (1)郵政劃撥—帳號：11136742；戶名：台灣真空學會
  - (2)ATM 轉帳—銀行代碼：017（兆豐國際商業銀行）；帳號：02009-107351

真空技術在半導體產業之應用/研討會		
時 間	研 討 會 內 容	講 師 (現職)
08:40~09:00	報到／主持人致歡迎詞 (第一場國立成功大學-李欣縈) (第二場國立清華大學-闕郁倫)	
09:00~10:30	電漿輔助化學氣相沉積設備在目前半導體產業的應用	葉昌鑫 博士 (金屬工業研究發展中心)
10:30~10:40	茶敘時間	
10:40~12:10	The Modern PVD and Etching Equipments in the Semiconductor Industry	陳華夫 博士 (國立交通大學鑽石計劃推動辦公室－計劃專業執行長)
12:10~13:30	午餐時間	
13:30~15:00	殘留氣體分析儀(RGA)在半導體產業之 應用與維護	鄭國聲 總經理 (英福康有限公司)
15:00~15:30	茶敘時間	
15:30~17:00	儀器設備展示、介紹與技術討論	英福康 成大光電所、清大材料所

◎ 聯絡資訊：

1. 聯絡人：台灣真空學會秘書 曹櫻歷小姐
2. 洽詢電話：03-579-5046 電子信箱：[taiwanvacuum@taiwanvacuum.org](mailto:taiwanvacuum@taiwanvacuum.org)

【若遇不可預測之突發因素，本學會保有此辦法內容調整及變動權】